DIN 50455-2:1999-11 (D)

Prüfung von Materialien für die Halbleitertechnologie - Verfahren zur Charakterisierung von Fotolacken - Teil 2: Bestimmung der Lichtempfindlichkeit von Positiv-Fotolacken

Inhalt

Seite

Vorwort 1

1 Anwendungsbereich 1

2 Normative Verweisungen 1

3 Kurzbeschreibung des Verfahrens 1

4 Formelzeichen und Einheiten 1

5 Definitionen 2

6 Geräte und Materialien 2

7 Durchführung 3
7.1 Allgemeines 3
7.2 Auftragung des Fotolackes 3
7.3 Belichtung 3
7.4 Entwicklung 3

8 Auswertung 3

9 Präzision des Verfahrens 3

10 Prüfbericht 4